



# Study of surface phenomena acting during ion beam oxidation of semiconductor and chemical etching of ultra-thin oxides [

Alay, Josep Lluís

Publicacions Universitat de Barcelona,  
1992

Monografia

<https://rebiunoda.pro.baratznet.cloud:38443/OpacDiscovery/public/catalog/detail/b2FpOmNlbGVicmF0aW9uOmVzLmJhemF0ei5yZW4vMjc5NTMzNTk>

---

**Título:** Study of surface phenomena acting during ion beam oxidation of semiconductor and chemical etching of ultra-thin oxides [Microforma] Josep Lluís Alay i Rodríguez

**Editorial:** Barcelona Publicacions Universitat de Barcelona 1992

**Descripción física:** 1 microfita 11x15 cm + 1 fullet (9 p. ; 16 cm)

**Mención de serie:** Col·lecció de tesis doctorals microfita 2309

**Nota general:** A la contraportada: Divisió: Ciències Experimentals i Matemàtiques. Departament: Física Aplicada i Electrònica

**Tesis:** Tesis doctoral, Universitat de Barcelona, 1993

**Bibliografía:** Bibliografia

**Copyright/Depósito Legal:** B 9351-1995 Biblioteca de Catalunya

**ISBN:** 844750719X

**Materia:** Superficies (Tecnología) Oxidación. Semiconductores. Espectroscopia de rayos X. Superficies Semiconductores. Espectroscopia de rayos X.

**Entidades:** Universidad de Barcelona. Departament de Física Aplicada i Electrònica

**Punto acceso adicional serie-Título:** Col·lecció de tesis doctorals microfita 2309

---

## **Baratz Innovación Documental**

- Gran Vía, 59 28013 Madrid
- (+34) 91 456 03 60
- [informa@baratz.es](mailto:informa@baratz.es)